

大見研究室 和文 論文リスト

2006 年

- 1137(W) 大見忠弘、「半導体製造技術開発における産学官連携」、国際特許流通セミナー2006(独立行政法人 工業所有権情報・研修館)、2006年1月。
- 1138(W) 有馬健太、加藤潤、遠藤勝義、赤堀浩史、須川成利、寺本章伸、大見忠弘、「湿式洗浄プロセスを経た Si(110)表面の原子構造観察」。ゲートスタック研究会－材料・プロセス・評価の物理－第11回研究会、((社)応用物理学会 薄膜・表面物理分科会/シリコンテクノロジー分科会共催)、pp.19-24、2006年1月。
- 1139(W) 樋口正顕、品川誠治、池永英司、小林啓介、野平博司、寺本章伸、服部健雄、須川成利、大見忠弘、「NH₃による直接窒化膜特性のシリコン結晶面密度依存性」。ゲートスタック研究会－材料・プロセス・評価の物理－第11回研究会、((社)応用物理学会 薄膜・表面物理分科会/シリコンテクノロジー分科会共催)、pp.97-102、2006年1月。
- 1140(W) 渡辺一史、寺本章伸、黒田理人、須川成利、大見忠弘、「Hole 注入法による NBTI 寿命予測」。ゲートスタック研究会－材料・プロセス・評価の物理－第11回研究会、((社)応用物理学会 薄膜・表面物理分科会/シリコンテクノロジー分科会共催)、pp.367-372、2006年1月。
- 1141(F) 大見忠弘、平山昌樹、白井泰雪、寺本章伸、「サブ 100nm 半導体技術の課題と展望」。電子情報通信学会誌、Vol.89、No.2、((社)電子情報通信学会)、2006年2月。
- 1142(M) 大見忠弘、平山昌樹、白井泰雪、寺本章伸、程イトウ、井ノ口敦智、「大学研究室紹介－東北大学未来科学技術共同研究センター－シリコン産業に革命を起す半導体製造装置」。SEAJ Journal、((社)日本半導体製造装置協会)、pp.32-37、No.101、2006年3月。
- 1143(W) 大見忠弘、森本明大、白方恭、「消費電力 1/10 を目指す回路基板」。第 53 回応用物理学関係連合講演会講演予稿集 No.0、((社)応用物理学会)、24p-C-3、pp.50、2006年3月。
- 1144(W) 大見忠弘、「基調講演－次世代エレクトロニクスにおける研究開発指針」。情報とエネルギーシンポジウム、(独立行政法人 産業技術総合研究所)、pp.59-94、2006年3月。
- 1145(W) 大見忠弘、小谷光司、「VDEC、その設立前夜から今日まで、そして将来－新しいシリコン技術の創出－」。東京大学大規模集積システム設計教育研究センター設立 10 周年記念シンポジウム、(東京大学大規模集積システム設計教育研究センター)、pp.4-10、2006年5月。
- 1146(C) 森永 均、島岡健治、大見忠弘、「シリコン表面マイクロラフネスの発生メカニズムと低減技術」。電子情報通信学会技術研究報告、Vol.106、No.108、((社)電子情報通信学会)、SDM2006-50、pp.49-54、2006年6月。
- 1147(C) 樋口正顕、品川誠治、寺本章伸、野平博司、服部健雄、池永英司、須川成利、大見忠弘、「直接窒化膜特性のシリコン結晶面密度依存性」。電子情報通信学会技術研究報告、Vol.106、No.108、((社)電子情報通信学会)、SDM2006-54、pp.71-76、2006年6月。
- 1148(F) 森本明大、杉村正彦、河田敦、川崎雅史、脇坂康尋、大見忠弘、「表面平滑低損失樹脂を用いた高速信号配線」。エレクトロニクス実装学会誌、Vol.9、No.4、((社)エレクトロニクス実装学会)、pp.262-268、2006年7月。
- 1149(M) 舘 知恭、須川成利、小谷光司、大見忠弘、「高機能高画質 CMOS イメージセンサ」。VDEC 平成 18 年東京大学大規模集積システム設計教育研究センター年報、(東京大学)、pp.183、2006年9月。
- 1150(M) 浄法寺 佑、大見忠弘、「イメージセンサ設計用 TEG」。VDEC 平成 18 年東京大学大規模集積システム設計教育研究センター年報、(東京大学)、pp.183、2006年9月。
- 1151(M) 渡部 俊一、大見忠弘、「MOS トランジスタ特性測定回路」。平成 18 年東京大学大規模集積システム設計教育研究センター年報、(東京大学)、pp.183、2006年9月。

- 1152(M) 舘 知恭、須川 成利、小谷 光司、大見 忠弘、「高機能高画質 CMOS イメージセンサ用 AD 変換器」。平成 18 年東京大学大規模集積システム設計教育研究センター年報、(東京大学)、pp.184、2006 年 9 月。
- 1153(M) KHAN ASHFAQZZAMAN、宮本 直人、大見忠弘、「動的再構成 FPGA (フレキシブルプロセッサ 3)」。平成 18 年東京大学大規模集積システム設計教育研究センター年報、(東京大学)、pp.233、2006 年 9 月。
- 1154(M) Warih Kurniawan、宮本 直人、大見忠弘、「動的再構成 FPGA (フレキシブルプロセッサ 3)」。平成 18 年東京大学大規模集積システム設計教育研究センター年報、(東京大学)、pp.233、2006 年 9 月。
- 1155(W) 諏訪智之、熊谷勇喜、寺本章伸、須川成利、大見忠弘、「大規模アレイTEGにより評価した低ビットエラーの Kr/O₂/NO トンネル酸化膜の形成」。電子情報通信学会技術研究報告、Vol.106、No.277、((社)電子情報通信学会)、SDM2006-173、pp.7-11、2006 年 10 月。
- 1156(W) 荒谷崇、樋口正顕、濱田龍文、寺本章伸、服部健雄、須川成利、大見忠弘、品川誠治、野平博司、池永英司、「Si(100)、(110)面上の極薄 Si₃N₄ 界面構造とその電気的特性」。電子情報通信学会技術研究報告、Vol.106、No.277、((社)電子情報通信学会)、SDM2006-175、pp.15-19、2006 年 10 月。
- 1157(W) 阿部健一、渡部俊一、須川成利、寺本章伸、大見忠弘、「微細 MOS トランジスタ特性の統計的ばらつき評価手法に関する研究」。電子情報通信学会技術研究報告、Vol.106、No.277、((社)電子情報通信学会)、SDM2006-189、pp.63-66、2006 年 10 月。
- 1158(W) 池永和幸、後藤哲也、寺本章伸、平山昌樹、野沢俊久、大見忠弘、「2 段シャワープレート型マイクロ波プラズマエッチャーを用いた多層膜の連続エッチング」。電子情報通信学会技術研究報告、Vol.106、No.277、((社)電子情報通信学会)、SDM2006-191、pp.71-74、2006 年 10 月。
- 1159(W) 河瀬康弘、北野真史、佐伯雅之、水谷文一、白井泰雪、大見忠弘、「陽極酸化によるアルミニウム表面への不動態膜形成技術」。電子情報通信学会技術研究報告、Vol.106、No.277、((社)電子情報通信学会)、SDM2006-193、pp.81-86、2006 年 10 月。
- 1160(W) 中山貴裕、譽田正宏、大見忠弘、「ベクトル量子化コードブックヒストグラム法による画像コンテンツ認識技術」。第 21 回信号処理シンポジウム、B6-4、2006 年 11 月。
- 1161(W) 河瀬康弘、北野真史、佐伯雅之、水谷文一、白井泰雪、大見忠弘、「陽極酸化による LSI/FPD 用アルミニウム合金チャンバー表面への不動態膜形成技術」、第 18 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.31-37、2006 年 11 月。
- 1162(W) 諏訪智之、熊谷勇喜、寺本章伸、須川成利、大見忠弘、「大規模アレイ TEG により評価した低ビットエラーの Kr/O₂/NO トンネル酸化膜の形成」、第 18 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.39-44、2006 年 11 月。
- 1163(W) 渡部俊一、阿部健一、須川成利、寺本章伸、大見忠弘、「微細 MOS トランジスタ特性の統計的ばらつき評価手法に関する研究」、第 18 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.45-48、2006 年 11 月。
- 1164(W) 大見忠弘、「"新事業創出に不可欠な新技術開発"-リニア型モデルからターゲットドリブン型モデルへの転換-」、第 18 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.61-73、2006 年 11 月。
- 1165(W) 田中康太郎、寺本章伸、須川成利、大見忠弘、「SiC 基板上高品質ゲート絶縁膜の低温形成」。電子情報通信学会技術研究報告、Vol.106、No.417、((社)電子情報通信学会)、SDM2006-209、pp.43-47、2006 年 12 月。